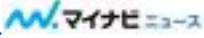
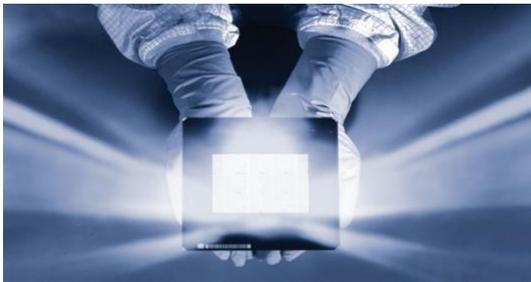


Toppan Photomask and EVG Collaborate on Nanoimprint for Photonics Manufacturing –
September 26, 2022

トッパンフォトマスクとEVG、フォトニクス製造向けナノインプリントで協業

2022年09月26日13時53分 / 提供： [マイナビニュース](#) 



MEMSおよび半導体市場向けのウェハボンディングおよびリソグラフィ装置プロバイダのオーストリア EV Group(EVG)と凸版印刷より2022年4月に企業分割されたトッパンフォトマスクは、フォトニクス産業向けに大量生産(HVM)プロセスを可能にするナノインプリントリソグラフィ(NIL)の拡販活動を共同で行っていくことを発表した。

今回の協業は、NIL装置のトップサプライヤであるEVGと、半導体用フォトマスクの代表的プロバイダであるトッパンフォトマスクの強みを活かし、NILをフォトニクス製造の業界標準プロセスとして確立し、量産段階での実装を加速させ、さまざまなアプリケーションへの展開を目指すというもの。主な用途としてはAR(拡張現実)ヘッドセット、スマートフォンや車載用センサ、医療用画像システムなどが想定されている。

<https://www.mapion.co.jp/news/column/cobs2484739-1/>